

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2009年2月12日 (12.02.2009)

PCT

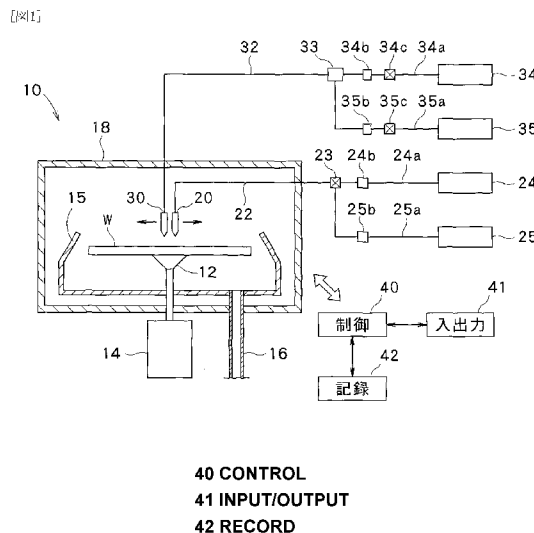
(10) 国際公開番号
WO 2009/019987 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01) G02F 1/13 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01) G02F 1/1333 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/063263
- (22) 国際出願日: 2008年7月24日 (24.07.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-202835 2007年8月3日 (03.08.2007) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)
- [JP/JP]: 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 広城 幸吉 (HIROSHIRO, Koukichi) [JP/JP]: 〒8410074 佐賀県鳥栖市西新町1375-41 東京エレクトロン九州株式会社内 Saga (JP). 戸島 孝之 (TOSHIMA, Takayuki) [JP/JP]: 〒8611116 熊本県合志市福原1-1 東京エレクトロン九州株式会社内 Kumamoto (JP).
- (74) 代理人: 吉武 賢次, 外(YOSHITAKE, Kenji et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル323号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE,

[続葉有]

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD, SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS, PROGRAM, RECORDING MEDIUM AND SUBSTITUTING AGENT

(54) 発明の名称: 基板処理方法、基板処理装置、プログラム、記録媒体および置換剤



(57) Abstract: Provided is a substrate processing method wherein a plurality of kinds of liquids are used. In the method, the liquid left on the substrate after processing by using the liquid is speedily and surely substituted with the liquid to be subsequently used. The method is provided with a step of processing a substrate (W) with the processing liquid, and a step of supplying a substituting liquid on the substrate and substituting the processing liquid left on the substrate with the substituting liquid. The substituting liquid to be used in the substituting step has a surface tension smaller than that of the processing liquid and has the same density as that of the processing liquid.

(57) 要約: 複数種類の液体を用いる基板処理方法において、液体を用いた処理の後に基板上に残留している当該液体を、次に使用される液体によって迅速かつより確実に置換することができる基板処理方法を提供する。基板処理方法は、処理液によって基板Wを処理する工程と、基板上に置換液を供給し、基板上に残留する処理液を置換液

[続葉有]



DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

添付公開書類:

— 国際調査報告書